

2018年8月31日

各位

住友金属鉱山株式会社

## 近赤外線遮蔽微粒子分散体に関する特許侵害訴訟の和解成立について

住友金属鉱山株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 野崎明）は、韓国Nexfil社に対し、同社の製品の一部が当社の保有する近赤外線遮蔽微粒子分散体<sup>(※)</sup>に関する韓国特許権を侵害していることを理由として、2018年3月5日にソウル中央地方法院において訴訟を提起しましたが、今般、本訴訟において和解が成立しましたのでお知らせいたします。

今回の和解では、当社の特許権が尊重され保護される内容にて合意がなされており、当社は、同内容に満足しております。

当社は、知的財産権が当社グループを支える重要な財産であることを認識し、その創造に努めるとともに、自社及び他社の知的財産権を尊重し、事業活動を推進しています。当社知的財産権の侵害に対しては、その適切な保護を図るべく、必要に応じて法的処置を含む対応を行います。

当社は、これらの活動を通じて、お客様が当社製品を安心してご使用いただけるよう、引き続き努めてまいります。

(※) 当社は、近赤外線遮蔽微粒子分散体の製造に用いる近赤外線遮蔽微粒子分散粉（CWO<sup>®</sup>）及び分散液を製造・販売しております。

CWO<sup>®</sup>は、当社が他社に先駆け独自に開発、製品化したセシウム酸化タングステン材料で、高い可視光透過と大きな赤外線吸収を特徴としております。同材料は、高い近赤外線遮蔽効果の他、透明でかつ高い光熱変換効率を生む材料としても注目されており、現在、様々な用途で使用検討及び実用化がなされております。

当社は、CWO<sup>®</sup>が近年の地球温暖化に伴うエネルギー問題や環境問題を解決する材料として社会に貢献できる大いなる力を秘めた魅力ある製品と考えております。

CWO<sup>®</sup>は住友金属鉱山株式会社の登録商標です。

（本件に関するお問い合わせ）

住友金属鉱山株式会社

広報IR部 オリッシュ アマンダ

Tel：03-3436-7705

Fax：03-3434-2215